This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-157916

(43)公開日 平成11年(1999)6月15日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

FΙ

C 0 4 B 35/00 H 0 1 L 21/3065 C 0 4 B 35/00

Н

H01L 21/302

В

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特顧平9-328449

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

(22)出庭日

平成9年(1997)11月28日

京都府京都市伏見区竹田島羽殿町6番地

(72) 発明者 伊東 裕見子

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

式会社総合研究所内

(72)発明者 会田 比呂史

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

式会社総合研究所内

(54) 【発明の名称】 耐食性部材

(57)【要約】

【課題】従来から用いられているガラス、石英、ステンレス、アルミナ、A1Nの焼結体は、塩素系プラズマに対して十分な耐食性を示さず、焼結体においては、腐食が徐々に進行して焼結体の表面から結晶粒子の脱粒が生じ、パーティクルが発生するなどの問題があった。

【解決手段】BC 1_3 やC 1_2 などの塩素系腐食ガス或いはそのプラズマに曝される部位を、Y、La、Ce、Nd、Dyなどの周期律表3a族金属と、A 1 及び/又はS i を含む複合酸化物、例えば、3 Y $_2$ O $_3$ · 5 A 1 $_2$ O $_3$ 、2 Y $_2$ O $_3$ · A 1 $_2$ O $_3$ 、Y $_2$ O $_3$ · A 1 $_2$ O $_3$ 、Y $_2$ O $_3$ · A 1 $_2$ O $_3$ 、Y $_4$ O $_3$ · A 1 $_2$ O $_3$ 、Y $_4$ O $_3$ · A 1 $_4$ O $_3$ 、Y $_4$ O $_3$ · A 1 $_4$ O $_3$ 、Y $_4$ O $_3$ · A 1 $_5$ O $_5$ · A 1 1 1 · A 1 ·

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED COMMUNICATION

Tom,

Here is one of several data summaries from Japanes patent applications.

(21)Application number: 09328449

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

(22)Date of filing: 28.11.1997

(72)Inventor:

ITOU YUMIKO AIDA HIROSHI

(54) CORROSION-RESISTANT MEMBER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a corrosion-resistant member having high corrosion resistance, especially to a chlorine-based corrosive gas and a chlorine based plasma and used as an internal wall material, a jig, etc., in the interior of a plasma treating device or a plasma processing device for producing a semiconductor or for a liquid crystal or a discharge wall of a discharge tube, a lamp, etc., such as a metal halide lamp. SOLUTION: A site exposed to a chlorine-based corrosive gas such as BCl3 or Cl2 or its plasma is composed of a sintered product or the like of a group 3a metal of the periodic table such as Y, La, Ce, Nd or Dy and a compound oxide containing Al and/or Si, e.g. 3Y2O3.5Al2O3, 2Y2O3.Al2O3, Y2O3.Al2O3, a disilicate or a monosilicate and the total amount of impurity metals other than the metals forming the compound oxide in the site is controlled to 0.1 wt.%.

Etch condtions: BCl3 or Ar:Cl2 ((2:3) ratio) used. 13.56MHz frequency.

	Material	Form :	Etch gas	Etch rate	Appearance	Impurities	Rating	5	
裁	材料	科組	エッチング	エッチングレート	表面状態	不純物量	評価		
No		形態	が種	Å/min		(ppm)			
I	Y203 · SiO2	ガラス	BC1 ₃	89	やや雪る	300	0	Slight	
2	"	77	ClztAr	80	やや曇る	400	0	haze	
3	27203 · SiOz	ガラス	BC1 ₃	76	やや量る	380	0		
4	MdzO3 · SiOz · AlzO3	ガラス	BC13	69	やや暑る	400	0		
_ 5	Dy203 · SiO2 · A1203	ガラス	BC13	72	やや量る	450	0		
6	Y ₂ O ₃ · SiO ₂	焼結体	BC13	77	変化なし	300	0	No effect	
7	2Yz03 · \$i0z	焼結体	BC13	68	変化なし	290	0		
8	Ybz0a · SiOz	焼結体	BCls	79	変化なし	220	0		
9	77	11	Clz+Ar	62	変化なし	220	0		
10	YA10s(YAP)	焼結体	BCl ₃	50	変化なし	240	0		
11	.IT	11	Cl ₂ +Ar	33	変化なし	240	0		
12	YaAlsO1g(YAG)	焼結体	BC13	53	変化なし	210	0		
13	n	"	Clz+Ar	35	変化なし	210	0		
14	Y4AlzO9(YAM)	焼結体	BCla	48	変化なし	290	0		
15	<i>)</i> /	II.	Cl ₂ +Ar	29	変化なし	290	0		
16	Dy4Al2O9	焼結体	BCls	53	変化なし	300	0		
17	YbaAlaO ₁₂	焼結体	BC13	47	変化なし	210	0		
18	н	"	C1 _z +Ar	31	変化なし	210	② :		
19	2Scz03 · 3A1z03	PVD	BC1a	27	変化なし		©		
20	Laz03 · 2A1203	PVD.	BC1a	32	変化なし		0		
*21	BN	焼結体	BC13	450	白く曇る	460	×	White h	
*22	石英(SiOg)	焼結体	BC1a	570	白濁		×	Frosted	
+23	H	jf	Cl _z +Ar	610	白濁		×		
*24	A12 Os	焼結体	BC1 ₃	260	20多数	150	×	Pitted	
+25	ll .	Ħ	·Clz+Ar	180	窪み多数	150	×		
*26	AlN	焼結体	BC13	920	曇る	380	×	haze	
*27	<i>II</i> .	77	Clz+Ar	740	曇る	380	×		

*印は本発明の範囲外の試料を示す。 Table 1. Effects of composition

Material	Form	Gas	Etch rate	Appearance	Impurities	Rating

料湖	材料	試料	エッチング	エッチングレート	表面状態	不純物量	評価	
No.		形態	放種	A/win		(ppm)		
28	Yb203 · SiO2	焼結体	BCls	73	変化なし	50	0	No effect
29	II.	//	#	75	変化なし	300	0	
30	/ /	//	//	80	やや量る	800	0	Slight haze
31	<i>II</i>	"	11.	83	突起有り	1200	Δ	Bumps
32	YA103(YAP)	焼結体	BCl ₃	46	変化なし	100	0	No effect
33	//	"	"	51	変化なし	450	0	
34	77	"	Ŋ	50	やや曇る	900	0	Slight haze
35	¶.	11	11	57	突起有り	1500	Δ	Bumps
36	Y3A15012(YAG)	焼結体	BC13	46	変化なし	50	0	No effect
37	N.	#	<i>II</i>	48	変化なし	400	0	
38	H .	"	77	52	やや曇る	900	0	Slight haze
39	11	"	n	63	窪み有り	1100	Δ	Pits
40	Y4A1209 (YAM)	焼結体	BCl3	44	変化なし	150	0	No effect
41	<i>)</i> ;	35	,,	46	変化なし	350	0	
42	//	n	"	48	やや曇る	850	0	Slight haze
43	H	11	//	55	盤み有り	1700	Δ	Pits
44	YbaAlsO12	焼結体	BC13	45	変化なし	200	0	No effect
45	P	"	#	49	変化なし	450	0	
46	<i>II</i>	#	//	52	やや曇る	750	0	Slight haze
47	#	H	//	56	窪み有り	1300	Δ	Pits

Table 2. Effect of purity